

講演分科日程表 (分科別) I

北海道工業大学

大分類分科名 中分類分科名	9月4日(火)		9月5日(水)		9月6日(木)		9月7日(金)		9月8日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
本部共通行事										
第29回応用物理学会論文賞授賞式	G棟-C 20 11:00 ~ 12:00									
第29回応用物理学会論文賞受賞記念講演 (JJAP 論文賞)	G棟-B 85 10:00 ~ 10:30		2号-ZL 54 13:00 ~ 13:30		5号-ZR 99 9:00 ~ 9:30	2号-ZM 84 14:00 ~ 14:30	G棟-ZR 100 9:00 ~ 9:30	G棟-S 109 13:00 ~ 13:30		
	2号-ZQ 59 9:15 ~ 9:45		G棟-D 79 13:00 ~ 13:30			G棟-V 39 15:45 ~ 16:15				
第29回応用物理学会論文賞受賞記念講演 (JJAP 論文奨励賞)			G棟-L 95 13:00 ~ 13:30							
			G棟-T 110 13:00 ~ 13:20			G棟-ZF 82 13:15 ~ 13:35	G棟-S 109 11:30 ~ 11:50			
			G棟-ZH 70 13:30 ~ 13:50				G棟-S 109 11:50 ~ 12:10	G棟-ZH 69 13:30 ~ 13:50		
			G棟-Y 49 13:45 ~ 14:05							
第29回応用物理学会論文賞受賞記念講演 (解説論文賞)			G棟-V 61 15:15 ~ 15:35							
						G棟-B 75 13:00 ~ 13:30	2号-ZL 88 14:00 ~ 14:30	G棟-V 40 15:45 ~ 16:15		
第20回応用物理学会講演奨励賞贈呈式	G棟-C 4 12:00 ~ 12:45									
有機分子・バイオエレクトロニクス分科会奨励賞受賞記念講演			G棟-D 79 13:30 ~ 13:45							
プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演								2号-ZQ 34 13:15 ~ 13:45		
特別シンポジウム「応用物理とベンチャービジネス-学会発ベンチャーの起業に向けて-		G棟-D 6 13:30 ~ 16:00								
第41回スクール「スピネレクトロニクスの基礎-更なる展開と次世代エレクトロニクスデバイスのイノベーションに向けて-		3号-ZV 15 9:00 ~ 17:10								
第41回スクール「宇宙環境を利用した科学技術の展開」				3号-ZV 16 9:30 ~ 17:00						
評議員・代議員合同会議		G棟-C 20 16:30 ~ 18:00								
懇親会		HIT プラザ 20 18:30 ~ 20:00								
1. 放射線・プラズマエレクトロニクス										
関連シンポジウム				G棟-ZD 30 13:00 ~ 17:20					2号-ZQ 34 13:45 ~ 17:25	
第5回プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演									**2号-ZQ 34 13:15 ~ 13:45	
1.1 放射線・加速器・原子炉		G棟-ZC 34 13:00 ~ 18:00	G棟-ZD 34 9:00 ~ 12:00		G棟-ZC 35 9:30 ~ 12:30	G棟-ZC 35 13:30 ~ 18:15	G棟-ZC 35 9:30 ~ 12:30	G棟-ZC 35 13:30 ~ 18:15		
1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源	G棟-ZB 36 9:45 ~ 12:30	G棟-ZB 36 13:30 ~ 17:45	G棟-ZB 36 9:45 ~ 12:30							
1.3 反応性プラズマの診断と計測									G棟-ZD 37 9:00 ~ 12:00	G棟-ZD 37 13:00 ~ 14:30
1.4 プラズマ応用プロセス	G棟-ZA 37 9:45 ~ 12:30	G棟-ZA 37 13:30 ~ 17:30								
1.5 プラズマプロセスによるナノテクノロジー			G棟-ZE 37 9:00 ~ 12:30							
1.6 プラズマ現象一般					G棟-ZD 38 9:30 ~ 12:30	G棟-ZD 38 13:30 ~ 16:45				
1.7 プラズマエッチング			G棟-ZA(ショート) →ポスター 38 9:30 ~ 11:20	15:30 ~ 17:30	G棟-ZA(ショート) →ポスター 38 9:30 ~ 11:30	13:00 ~ 15:00				
2. 計測・制御										
2.1 計測・制御技術							G棟-V 39 9:30 ~ 12:30	G棟-V 39 13:30 ~ 15:30		
2.2 精密計測・ナノ計測						*G棟-V 39 13:30 ~ 18:00				
2.3 計測標準							*G棟-V 40 15:45 ~ 17:00	G棟-V 40 9:00 ~ 12:00	G棟-V 40 13:00 ~ 14:45	
3. 光										
関連シンポジウム				G棟-R 30 13:00 ~ 16:50						
3.1 物理光学・光学基礎							G棟-X 40 9:30 ~ 10:30			
3.2 材料光学						G棟-R 40 13:00 ~ 17:15				
3.3 機器・デバイス光学					G棟-R(ショート) →ポスター 40 10:00 ~ 11:20	15:30 ~ 17:30	G棟-R(ショート) →ポスター 41 9:00 ~ 10:00	15:30 ~ 17:30		
3.4 計測光学		G棟-R 41 13:00 ~ 16:45	G棟-R 41 9:00 ~ 12:00							
3.5 情報光学								G棟-X 41 13:00 ~ 18:30		
3.6 視覚・色彩						G棟-X 42 18:15 ~ 18:30				
3.7 生体・医用光学						G棟-X 42 13:30 ~ 18:15				
3.8 近接場光学							G棟-Q 42 9:00 ~ 12:00	G棟-Q 42 13:00 ~ 17:00	G棟-Q 43 9:00 ~ 12:00	G棟-Q 43 13:00 ~ 15:00
3.9 光学新領域							G棟-X 43 10:30 ~ 12:00			

会場名の前は、建物を表示 (例: G棟-C は G棟の C 会場)
 * 応用物理学会論文賞受賞記念講演あり。
 ** プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演あり。
 シンポジウムは、13 頁参照

【建物略称】
 G棟 → G棟
 2号館 → 2号
 3号館 → 3号
 5号館 → 5号
 体育館 → 体育

講演分科日程表（分科別）II

北海道工業大学

大分類分科名 中分類分科名	9月4日(火)		9月5日(水)		9月6日(木)		9月7日(金)		9月8日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
4. 量子エレクトロニクス										
4.1 量子光学・原子光学										
4.2 フォトニックナノ構造・現象					体育-P9 43 9:30 ~ 11:30	体育-P11 43 13:00 ~ 15:00	G棟-R 44 10:45 ~ 13:00	G棟-R 44 14:00 ~ 19:00	5号-ZS 44 9:00 ~ 12:00	5号-ZS 45 13:00 ~ 15:00
4.3 レーザー装置・材料							G棟-F 45 9:00 ~ 12:00	G棟-F 45 12:45 ~ 19:00	G棟-F 45 9:00 ~ 12:00	G棟-F 46 12:45 ~ 15:00
4.4 超高速・高強度レーザー					G棟-Y 46 9:30 ~ 12:30	G棟-Y 46 13:30 ~ 18:00	G棟-Y 46 9:30 ~ 12:30	G棟-Y 47 13:30 ~ 17:45		
4.5 テラヘルツ全般・非線形光学					G棟-ZB 47 9:30 ~ 12:30	G棟-ZB 47 13:30 ~ 18:30	G棟-ZB 48 9:30 ~ 12:30	G棟-ZB 48 13:30 ~ 18:45		
4.6 レーザー分光応用・計測								G棟-ZA 48 13:30 ~ 16:00		
4.7 レーザー・プロセッシング	G棟-Y 48 9:30 ~ 12:30	G棟-Y 49 13:30 ~ 17:00	G棟-Y 49 9:30 ~ 12:30	*G棟-Y 49 13:30 ~ 17:35						
5. 光エレクトロニクス										
関連シンポジウム				G棟-B 30 13:15 ~ 17:30		G棟-C 32 13:00 ~ 17:15				
5.1 半導体レーザー・発光素子					G棟-C 49 9:00 ~ 11:45		G棟-C 50 9:00 ~ 12:30	G棟-C 50 13:30 ~ 18:00	G棟-C 50 9:00 ~ 12:00	
5.2 光検出					G棟-Q 51 9:30 ~ 11:30					
5.3 光記録						G棟-Q 51 13:00 ~ 17:45				
5.4 光制御	体育-P1 51 9:30 ~ 11:30	体育-P3 52 13:00 ~ 15:00	体育-P5 52 9:30 ~ 11:30			G棟-N 53 13:00 ~ 13:30				
5.5 光ファイバー						G棟-N 53 13:30 ~ 18:30				
6. 薄膜・表面										
関連シンポジウム	G棟-F 29 9:00 ~ 16:25									
		2号-ZQ 29 13:00 ~ 17:20								
6.1 強誘電体薄膜	2号-ZL 53 10:00 ~ 13:00	2号-ZL 53 14:00 ~ 17:45	2号-ZL 54 9:00 ~ 12:00	*2号-ZL 54 13:00 ~ 18:30	3号-ZV 54 10:00 ~ 12:30					
6.2 カーボン系薄膜			G棟-F 54 9:00 ~ 12:00	G棟-F 55 13:00 ~ 19:00	G棟-F 55 9:00 ~ 12:00	G棟-F 55 13:00 ~ 18:30				
6.3 酸化エレクトロニクス	5号-ZT 56 10:00 ~ 13:00	5号-ZT 56 14:00 ~ 17:30	5号-ZT 56 10:00 ~ 13:00	5号-ZT 56 14:00 ~ 18:30	5号-ZT 57 10:00 ~ 13:00	5号-ZT 57 14:00 ~ 18:30	5号-ZT 57 10:00 ~ 13:00	5号-ZT 57 14:00 ~ 18:00		
6.4 薄膜新材料					G棟-H 58 9:00 ~ 12:00	G棟-H 58 13:00 ~ 18:30	G棟-H 58 9:00 ~ 12:00	G棟-H 59 13:00 ~ 18:30		
6.5 表面物理・真空	*2号-ZQ 59 9:00 ~ 12:00		G棟-ZC 59 9:00 ~ 12:00	G棟-ZC 59 13:00 ~ 18:45						
6.6 プロブ顕微鏡							体育-P13 60 9:30 ~ 11:30	体育-P15 60 13:00 ~ 15:00		
7. ビーム応用										
関連シンポジウム	G棟-X 29 9:30 ~ 17:30									
		2号-ZN 29 13:00 ~ 17:00								
7.1 X線技術			G棟-V 61 9:30 ~ 12:30	*G棟-V 61 13:30 ~ 17:50	G棟-V 62 9:30 ~ 12:30					
7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析	G棟-V 62 9:30 ~ 12:30	G棟-V 62 13:30 ~ 16:00								
7.3 リソグラフィ			G棟-C(ショート) 9:20 ~ 11:30	→ポスター 62 13:00 ~ 15:00						
7.4 ナノインプリント	2号-ZN 63 10:00 ~ 11:45			G棟-W 63 13:15 ~ 18:00						
7.5 ビーム・光励起表面反応							G棟-W 63 10:30 ~ 12:30	G棟-W 64 13:30 ~ 15:15		
7.6 イオンビーム一般	G棟-W 64 9:30 ~ 12:30	G棟-W 64 13:30 ~ 17:30								
7.7 微小電子源					G棟-W 64 9:30 ~ 12:30	G棟-W 64 13:30 ~ 18:00				
7.8 ビーム応用一般・新技術					G棟-B 65 9:00 ~ 12:00					
8. 応用物性										
関連シンポジウム						G棟-S 33 13:25 ~ 17:45				
8.1 磁性材料・磁気デバイス							G棟-ZD 65 9:30 ~ 12:30	G棟-ZD 65 13:30 ~ 17:15		
8.2 誘電材料・誘電体				G棟-ZK 66 13:30 ~ 18:00						
8.3 微粒子・粉体					G棟-ZK 66 9:15 ~ 12:30					
8.4 ナノエレクトロニクス							体育-P14 66 9:30 ~ 11:30			
8.5 熱電変換						G棟-ZK 67 13:30 ~ 17:30	G棟-ZK 67 9:30 ~ 12:30	G棟-ZK 67 13:30 ~ 17:30		
8.6 新機能材料・新物性			G棟-ZK 67 9:30 ~ 12:15							
9. 超伝導										
9.1 基礎物性	G棟-ZF 68 9:30 ~ 12:30	G棟-ZF 68 13:30 ~ 17:15								
9.2 新材料, 新薄膜, 新低温動作デバイス		G棟-ZE 68 13:30 ~ 16:00								
9.3 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長					G棟-ZH 68 9:45 ~ 12:30	G棟-ZH 69 13:30 ~ 18:15				
9.4 臨界電流, 超伝導パワー応用							G棟-ZH 69 9:30 ~ 12:30	*G棟-ZH 69 13:30 ~ 16:50		
9.5 アナログ応用および関連技術		G棟-ZH 70 13:30 ~ 17:00	G棟-ZH 70 9:30 ~ 12:30	*G棟-ZH 70 13:30 ~ 17:05						
9.6 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	G棟-ZH(ショート) 10:00 ~ 11:40	→ポスター 70 13:00 ~ 15:00								

会場名の前は、建物を表示（例：G棟-YはG棟のY会場）
 *応用物理学論文賞受賞記念講演あり。
 シンポジウムは、13頁参照

【建物略称】
 G棟 → G棟
 2号館 → 2号館
 3号館 → 3号館
 5号館 → 5号館
 体育館 → 体育

講演分科日程表 (分科別) III

北海道工業大学

大分類分科名 中分類分科名	9月4日(火)		9月5日(水)		9月6日(木)		9月7日(金)		9月8日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
10. 有機分子・バイオエレクトロニクス										
関連シンポジウム				G棟-C 31 13:00 ~ 17:50		G棟-D 32 13:00 ~ 17:30		5号-ZR 33 13:00 ~ 17:15		
				G棟-H 31 13:00 ~ 17:20				G棟-D 33 13:30 ~ 17:20		
10.1 作製技術					G棟-M 71 9:00 ~ 12:00	G棟-M 71 13:00 ~ 18:45	G棟-M 71 9:00 ~ 12:00	G棟-M 72 13:00 ~ 18:45		
10.2 評価・基礎物性							G棟-B 72 9:00 ~ 12:15	G棟-B 72 13:15 ~ 17:30	G棟-B 73 9:00 ~ 12:00	G棟-B 73 13:00 ~ 15:00
10.3 電子機能材料・デバイス					5号-ZS 73 14:00 ~ 18:00		2号-ZN 73 9:00 ~ 12:00	2号-ZN 74 13:00 ~ 17:15	2号-ZN 74 10:00 ~ 13:00	
10.4 光機能材料・デバイス								G棟-A 74 13:00 ~ 17:45	G棟-A 74 9:00 ~ 12:00	G棟-A 75 13:00 ~ 14:45
10.5 液晶							*G棟-B 75 13:00 ~ 16:30			
10.6 高分子・ソフトマテリアル		G棟-H 75 13:00 ~ 17:00	G棟-H 75 9:00 ~ 11:30							
10.7 生物・医用工学・バイオチップ				G棟-A 76 9:00 ~ 12:00	G棟-A 76 13:00 ~ 18:15	G棟-A 76 9:00 ~ 12:00	G棟-A 76 13:00 ~ 18:15	G棟-A 77 9:00 ~ 12:00		
10.8 有機EL		5号-ZS 77 14:00 ~ 17:45	2号-ZM 77 10:00 ~ 13:00	2号-ZM 78 14:00 ~ 17:45						
10.9 特定テーマA:有機トランジスタ	G棟-D(ショート) 9:00 ~ 11:35	→ポスター 78 15:30 ~ 17:30	G棟-D 78 9:00 ~ 12:00	*G棟-D 79 13:00 ~ 18:15	G棟-D 79 9:00 ~ 12:00			G棟-D 79 9:00 ~ 12:00		G棟-D 79 9:00 ~ 11:45
10.10 特定テーマB:生体分子計測・バイオナノテクノロジー		体育-P4 80 15:30 ~ 17:30		体育-P8 80 15:30 ~ 17:30		体育-P12 81 15:30 ~ 17:30				G棟-D 80 13:00 ~ 15:00
11. 半導体A (シリコン)										
関連シンポジウム				2号-ZQ 30 13:00 ~ 17:30		G棟-ZE 32 13:00 ~ 17:30		G棟-ZF 33 10:15 ~ 16:05		
				G棟-K 31 13:00 ~ 18:00						
11 分科内総合講演: LSI多層配線の微細化限界とブレイクスルー技術						#2号-ZQ 81 10:00 ~ 12:10	#2号-ZQ 81 13:15 ~ 17:00			
11.1 基礎物性・評価			G棟-ZF 82 9:30 ~ 12:30	G棟-ZF 82 13:30 ~ 18:00						
11.2 半導体表面					G棟-ZF 82 9:30 ~ 12:15	*G棟-ZF 82 13:15 ~ 17:50			G棟-ZF 83 9:00 ~ 12:15	
11.3 絶縁膜技術	2号-ZM 83 9:45 ~ 13:00	2号-ZM 83 14:00 ~ 17:00	2号-ZQ 83 9:30 ~ 12:00		2号-ZM 84 10:15 ~ 13:00	*2号-ZM 84 14:00 ~ 18:30	2号-ZM 84 9:30 ~ 12:45	2号-ZM 85 14:00 ~ 18:00	2号-ZM 85 9:15 ~ 12:30	
11.4 配線技術	*G棟-B 85 10:00 ~ 12:00	G棟-B 85 13:00 ~ 18:00	G棟-B 86 9:00 ~ 12:00							
11.5 Si プロセス技術	体育-P2 86 9:30 ~ 11:30		体育-P6 86 9:30 ~ 11:30			体育-P10 87 9:30 ~ 11:30				
11.6 Si デバイス/集積化技術				G棟-ZE 87 13:30 ~ 17:30	G棟-ZE 88 9:15 ~ 12:00		2号-ZL 88 10:00 ~ 13:00	*2号-ZL 88 14:00 ~ 19:00	2号-ZL 88 9:00 ~ 12:00	2号-ZL 89 13:00 ~ 15:00
11.7 シミュレーション							G棟-ZE 89 9:45 ~ 12:30	G棟-ZE 89 14:00 ~ 17:00		
12. 半導体B (探索的材料・物性・デバイス)										
関連シンポジウム		G棟-L 29 13:30 ~ 17:45		G棟-M 30 13:00 ~ 17:10		5号-ZR 32 13:00 ~ 17:00				
				5号-ZR 31 13:00 ~ 17:35						
12.1 探索的材料物性	G棟-Q 89 9:00 ~ 12:00	G棟-Q 90 13:00 ~ 17:00	G棟-Q 90 9:00 ~ 12:00	G棟-Q 90 13:00 ~ 17:45						
12.2 超薄膜・量子ナノ構造			G棟-N(ショート) 10:00 ~ 11:40	→ポスター 91 15:30 ~ 17:30	G棟-N(ショート) 9:45 ~ 12:00	→ポスター 91 15:30 ~ 17:30	G棟-N(ショート) 9:45 ~ 12:00	→ポスター 91 15:30 ~ 17:30		
12.3 プロセス技術・界面制御	G棟-N 92 9:00 ~ 11:45	G棟-N 92 13:00 ~ 17:45								
12.4 超高速・機能デバイス		#G棟-K 92 13:00 ~ 17:30	G棟-K 93 9:00 ~ 11:45		G棟-K 93 9:00 ~ 12:00	G棟-K 93 13:00 ~ 17:15				
12.5 半導体光物性・光デバイス	G棟-L 94 9:00 ~ 12:00		G棟-L 94 9:00 ~ 12:00	*G棟-L 95 13:00 ~ 18:00	#G棟-L 95 9:00 ~ 12:30	G棟-L 95 13:30 ~ 18:00	G棟-L 95 9:15 ~ 12:00	*G棟-L 96 13:00 ~ 17:20	G棟-L 96 9:00 ~ 12:00	G棟-L 96 13:00 ~ 15:00
	G棟-ZK 94 9:00 ~ 12:30	G棟-ZK 94 13:30 ~ 17:30								
13. 結晶工学										
関連シンポジウム		G棟-L 29 13:30 ~ 17:45		2号-ZN 30 13:00 ~ 17:25		2号-ZL 32 13:00 ~ 16:45				
				5号-ZR 31 13:00 ~ 17:35		5号-ZR 32 13:00 ~ 17:00				
13.1 バルク結晶成長							G棟-ZA(ショート) 11:05 ~ 12:30	→ポスター 96 15:30 ~ 17:30		
13.2 II-VI 族結晶			G棟-E 97 9:00 ~ 12:00	G棟-E 97 13:00 ~ 17:00						
13.3 III-V 族エピタキシャル結晶						G棟-E 97 13:00 ~ 17:45	G棟-E 98 9:00 ~ 12:00	G棟-E 98 13:00 ~ 18:00	G棟-H 98 9:00 ~ 12:15	
13.4 III-V 窒化物結晶	5号-ZR 99 10:30 ~ 13:00	5号-ZR 99 14:00 ~ 18:00	5号-ZR 99 9:45 ~ 12:00		*5号-ZR 99 9:00 ~ 11:30		*5号-ZR 100 9:00 ~ 11:45		5号-ZR 101 9:00 ~ 12:00	5号-ZR 101 13:00 ~ 15:00
		G棟-S 98 12:45 ~ 16:15			5号-ZS 100 9:00 ~ 12:00	5号-ZS 100 13:00 ~ 18:15	5号-ZS 100 10:00 ~ 13:00	5号-ZS 101 14:00 ~ 18:30	2号-ZQ 101 9:00 ~ 12:00	
13.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶	G棟-E 102 9:30 ~ 12:00	G棟-E 102 13:00 ~ 17:45								
13.6 IV 族系化合物	G棟-T 102 9:30 ~ 12:30	G棟-T 103 13:30 ~ 18:00	2号-ZN 103 9:00 ~ 12:00		2号-ZN 103 9:30 ~ 12:30	2号-ZN 103 13:30 ~ 17:00				
13.7 エピタキシーの基礎					G棟-E 104 9:00 ~ 12:15					
13.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥		G棟-A 104 13:00 ~ 17:45								

会場名の前は、建物を表示 (例: 5号-ZS は5号館のZS会場)
 # 分科内招待講演あり。
 ## 分科内総合講演あり。
 * 応用物理学論文賞受賞記念講演あり。
 ※有機分子・バイオエレクトロニクス分科会論文賞受賞記念講演あり。
 シンポジウムは、13頁参照

【建物略称】
 G棟 → G棟
 2号館 → 2号
 3号館 → 3号
 5号館 → 5号
 体育館 → 体育

講演分科日程表 (分科別) IV

北海道工業大学

大分類分科名 中分類分科名	9月4日(火)		9月5日(水)		9月6日(木)		9月7日(金)		9月8日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
14. 非晶質・微結晶										
関連シンポジウム							G棟-K 33 9:00 ~ 12:25			
14 分科内総合講演: 非晶質・微結晶 材料における未知物性の開拓						#3号-ZV 104 13:30 ~ 16:15		3号-ZV 33 13:00 ~ 16:25		
14.1 基礎物性・評価	G棟-M 104 10:00 ~ 11:30		G棟-W 104 9:30 ~ 12:00		G棟-X 105 9:30 ~ 12:00	3号-ZV 105 16:30 ~ 19:00				
14.2 プロセス技術		G棟-M 105 13:00 ~ 17:45								
14.3 デバイス							3号-ZV 105 10:00 ~ 11:45			
15. 応用物理一般										
関連シンポジウム				G棟-N 31 13:10 ~ 17:30						
				G棟-ZA 32 13:30 ~ 17:00						
15.1 応用物理一般			G棟-X 105 9:30 ~ 12:30	G棟-X 106 13:30 ~ 17:45						
15.2 教育			体育-P7 106 9:30 ~ 11:30							
15.3 新技術		G棟-ZD 106 13:30 ~ 15:30								
15.4 トライボロジー		G棟-ZD 106 15:45 ~ 17:00								
15.5 エネルギー変換・貯蔵	G棟-ZD 107 9:45 ~ 11:15									
15.6 資源・環境	G棟-ZD 107 11:30 ~ 12:30									
15.7 磁場応用			G棟-M 107 9:30 ~ 11:30							
合同セッション										
関連シンポジウム「合同D」								3号-ZV 33 13:00 ~ 16:25		
								2号-ZQ 34 13:45 ~ 17:25		
関連シンポジウム「合同E」						G棟-S 33 13:25 ~ 17:45				
関連シンポジウム「合同F」	G棟-F 29 9:00 ~ 16:25									
合同セッションD「プラズマCVD の基礎と応用」									3号-ZV 107 9:00 ~ 12:45	
合同セッションE「スピントロニクス・ ナノマグネティクス」	G棟-S 107 16:30 ~ 18:00	G棟-S 108 9:00 ~ 12:00	G棟-S 108 13:00 ~ 19:00	G棟-S 108 9:00 ~ 12:30			*G棟-S 109 9:00 ~ 12:10	*G棟-S 109 13:00 ~ 19:00	G棟-S 109 9:00 ~ 12:45	
合同セッションF「カーボンナノ チューブの基礎と応用」		G棟-T 109 9:00 ~ 12:00	*G棟-T 110 13:00 ~ 18:50	G棟-T 110 9:00 ~ 12:00	G棟-T 110 13:00 ~ 18:30	G棟-T 111 9:00 ~ 12:00	G棟-T 111 13:00 ~ 18:15	G棟-T 111 13:00 ~ 18:15	G棟-T 112 9:00 ~ 12:00	G棟-T 112 13:00 ~ 15:00
合同セッションG「量子情報の基礎 と応用」								G棟-N 112 13:00 ~ 16:30		
合同セッションK「酸化亜鉛系機能 性材料」			5号-ZS(ショート) 9:00 ~ 11:30	→ポスター 112 13:00 ~ 15:00	2号-ZL(ショート) 9:00 ~ 11:10	→ポスター 113 13:00 ~ 15:00	2号-ZQ(ショート) 9:00 ~ 11:50	→ポスター 113 13:00 ~ 15:00		

会場名の前は、建物を表示 (例: 3号-ZV は3号館のZV会場)
分科内総合講演あり。
* 応用物理学会論文賞受賞記念講演あり。
シンポジウムは、13頁参照

【建物略称】
G棟 → G棟
2号館 → 2号
3号館 → 3号
5号館 → 5号
体育館 → 体育

講演分科日程表について

(例)

9月4日(火)		9月5日(水)		9月6日(木)		9月7日(金)	
午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
G棟-ZH(ショート) 10:00~11:40	→ポスター12 13:00~15:00	P5 9:30~11:30	2号-ZL 13:00~18:30	G棟-Q 25 9:00~12:00	3号-ZV 26 13:00~18:00	G棟-M 28 9:00~12:00	5号-ZR 30 13:00~18:00
amがショート講演, pm がポスターセッションの 例		ポスターセッ ションのみ	場所の略記号 (2号館, ZL会場)	講演時間		プログラム掲 載頁	